

06;07

Природа белой фотолюминесценции в слоях $\text{SiO}_2:\text{C}$

© А.В. Васин, В.И. Кушниренко, В.С. Лысенко, А.Н. Назаров,
Yukari Ishikawa, J. Salonen

Институт физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева,
03026, Киев, Украина

Japan Fine Ceramics Center, Nagoya 456–8587, Japan
Department of Physics, University of Turku, Turku FI-20014, Finland
E-mail: vl_kush@ukr.net

В окончательной редакции 6 февраля 2009 г.

Слои оксида кремния, инкорпорированного углеродом ($\text{SiO}_2:\text{C}$), были синтезированы методом последовательной термической карбонизации/окисления пористого кремния. Полученные слои $\text{SiO}_2:\text{C}$ проявляли яркую белую фотолюминесценцию. Исследованы свойства излучения, возбуждения и релаксации белой фотолюминесценции слоев $\text{SiO}_2:\text{C}$. Установлено, что широкая полоса фотолюминесценции в действительности состоит как минимум из двух полос с максимумами интенсивности в зеленой и голубой области. На основании полученных данных предложена и обоснована модель возбуждения и излучательной рекомбинации в слоях $\text{SiO}_2:\text{C}$.

PACS: 61.43.Dq, 68.55.-a, 78.55.Qr, 78.66.Jg

Электронные свойства нанокристаллитов и нанокластеров полупроводниковых материалов имеют ряд специфических особенностей, связанных с квантово-размерными эффектами и большим вкладом электронных состояний, локализованных на границах раздела. Уникальные свойства наноразмерных объектов открывают принципиально новые направления развития современных технологий. Например, в последние годы большое внимание исследователей и технологов уделяется светоизлучающим свойствам нановключений элементов IV группы в матрице оксида кремния [1]. В частности, введение углерода в матрицу оксида кремния ($\text{SiO}_2:\text{C}$), при определенных условиях, приводит к возникновению интенсивной белой фотолюминесценции (ФЛ). Слои $\text{SiO}_2:\text{C}$ могут быть получены методами магнетронного распыления [2], плазмохимического осаждения [3] или имплантаций углерода в слои SiO_2 [4–7].

Недавно был предложен еще один простой и эффективный метод формирования слоев $\text{SiO}_2:\text{C}$ с помощью последовательной процедуры высокотемпературной карбонизации пористого кремния в атмосфере ацетилена с последующим полным прокислением кремниевого скелета в парах воды [8,9]. Было показано, что белая люминесценция полученных слоев связана с наличием углерода в матрице SiO_2 . Однако в этих и других работах не было проведено детального анализа физических механизмов фотолюминесценции. В предлагаемой работе проводится попытка сформулировать энергетическую модель фотолюминесценции в слоях $\text{SiO}_2:\text{C}$ на основе анализа условий возбуждения ФЛ и ее релаксационных свойств.

Исходные слои пористого кремния были получены электрохимическим травлением пластин кремния $\text{Si}(100)$ p^+ -типа ($0.015\text{--}0.025 \Omega \cdot \text{см}$) в растворе $\text{HF:C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (1:1). Толщина пористых слоев составляла около $2\text{ }\mu\text{m}$. Карбонизация пористого кремния проводилась в протоке $\text{N}_2/\text{C}_2\text{H}_2$ при температуре 650°C в течение 30 min. На данном этапе происходит формирование углеродного слоя на стенках пор. Следующим этапом подготовки образцов было окисление в потоке влажного аргона при температуре 800°C в течение 3 h. Как было показано ранее [8], пары воды при данной температуре окисляют пористый „скелет“ нанокристаллического кремния, но слабо реагируют с углеродом.

По аналогии с [8] и [9] полученные слои были изучены с помощью электронной дифракции, микроскопии высокого разрешения, спектроскопии характеристических потерь электронов и спектроскопии комбинационного рассеяния света. Результаты показали, что данные слои представляют собой оксид кремния с включениями кластеров углерода.

Спектры излучения ФЛ записывались при возбуждении азотным лазером ИЛГИ (длина волны излучения 337 nm, длительность импульса 10 ns, частота импульсов 100 Hz). Для некоторых экспериментов длительность импульса уменьшалась до 0.7 ns при той же частоте. Спектры возбуждения ФЛ измерялись с помощью ксеноновой лампы, излучение которой пропускалось через монохроматор МДР-23 и фокусировалось на образце. Измерения времен релаксации ФЛ проводились с помощью возбуждения импульсами излучения светодиода с длиной волны 373 nm и длительностью импульса 1.9 ns.

Спектры излучения ФЛ полученных слоев при возбуждении азотным лазером в обычном режиме (длительность импульса около 10 ns) и

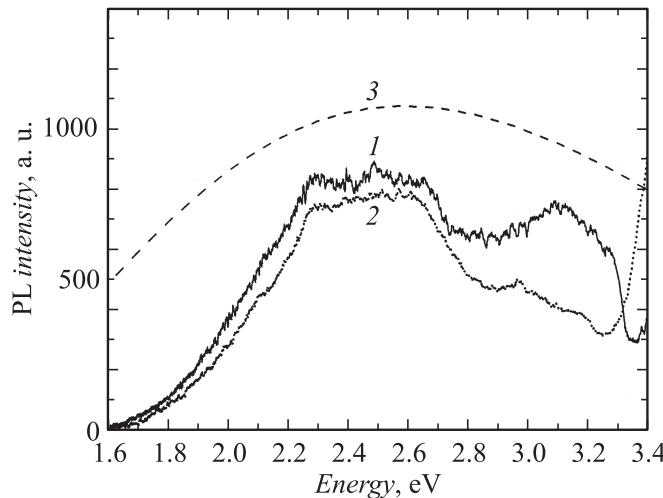


Рис. 1. Спектры ФЛ: 1 — возбуждение при длительности лазерного импульса 10 ns; 2 — возбуждение ультракороткими лазерными импульсами 0.7 ns; 3 — спектральное распределение интенсивности излучения абсолютно черного тела при температуре около 6000°С.

в режиме ультракоротких импульсов (длительность импульса около 0.7 ns) при комнатной температуре представлены на рис. 1. Спектр ФЛ представляет собой широкую полосу, перекрывающую весь видимый диапазон, с максимумом интенсивности в зеленой области около 2.4–2.5 eV и „голубым“ плечом с энергией 3.0–3.1 eV. Стоит отметить, что спектральное распределение интенсивности ФЛ полученных слоев близко к распределению интенсивности излучения абсолютно черного тела при температуре 6000°С в видимом диапазоне (рис. 1, пунктир), что приближенно соответствует спектральному распределению интенсивности в солнечном излучении.

Из рис. 1 видно, что уменьшение длительности импульса с 10 до 0.7 ns при комнатной температуре приводит к существенному уменьшению относительной интенсивности „голубого“ плеча в спектре ФЛ. Изменение относительной интенсивности „зеленой“ и „голубой“ части спектра ФЛ при изменении длительности импульса излучения лазера позволяет предположить, что природа центров излучательной

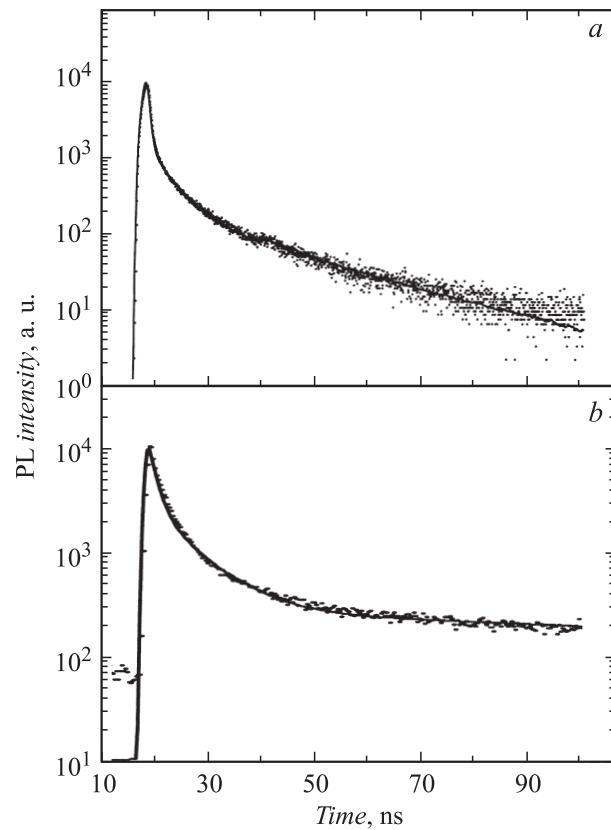


Рис. 2. Времяразрешенные спектры ФЛ: *a* — на длине волны 450 nm (2.75 eV), *b* — на длине волны 550 nm (2.25 eV).

рекомбинации в низкоэнергетической и высокоэнергетической части спектра различна. В связи с этим были проведены измерения времени затухания ФЛ на длине волны 550 nm (2.25 eV) и 450 nm (2.75 eV) (рис. 2). Из рисунка видно, что время релаксации ФЛ в голубой области значительно меньше, чем в низкоэнергетической части спектра. Детальная обработка экспериментальных данных показала, что спад интенсивности свечения как в высокочастотной, так и в низкочастотной

Параметры спада фотолюминесценции на длине волны 450 nm (2.75 eV) и 550 nm (2.25 eV): характерное время спада интенсивности τ_i и соответствующая относительная амплитуда $I_i(0)$

Номер компоненты, i	450 nm		550 nm	
	τ_i , ns	$I_i(0)$, %	τ_i , ns	$I_i(0)$, %
1	0.3	62	340.0	62
2	3.7	22	10.9	20
3	21	16	2.0	18

области спектра лучше всего описывается трехкомпонентной экспонентой с различными характерными временами релаксации τ , т.е. выражением:

$$I(t) = \sum_{i=1}^3 I_i(0) \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right).$$

В таблице приведены значения характерного времени затухания τ_i и относительной амплитуды $I_i(0)$ для каждой из трех экспонент. Относительные амплитуды интенсивности нормированы условием: $I_1(0) + I_2(0) + I_3(0) = 100\%$. Из таблицы видно, что основная часть состояний, излучающих в голубой части спектра, имеет время жизни порядка 0.3 ns, в то время как в низкоэнергетической области основной вклад в ФЛ дают состояния с временем жизни около 340 ns, т.е. время жизни центров отличается на три порядка, что является еще одним свидетельством того, что „голубая“ и „зеленая“ составляющие имеют различную природу. Очевидно, что в разупорядоченной аморфной структуре свойства локальных электронных состояний даже одного и того же типа структурного дефекта изменяются в широком диапазоне. Этим объясняются большая ширина полос ФЛ и разброс величины характерного времени затухания ФЛ. Для упрощения далее мы будем рассматривать только два типа излучательных состояний, отвечающих за высокоенергетическую и низкоэнергетическую часть спектра ФЛ.

Чтобы получить больше информации о механизме фотовозбуждения, были проведены измерения спектров возбуждения в длинноволновой и коротковолновой области спектра. В спектре возбуждения на длине волны 410 nm (3.02 eV) хорошо проявляется максимум при энергии около 3.6 eV (рис. 3, спектр 1). Из-за наложения излучения

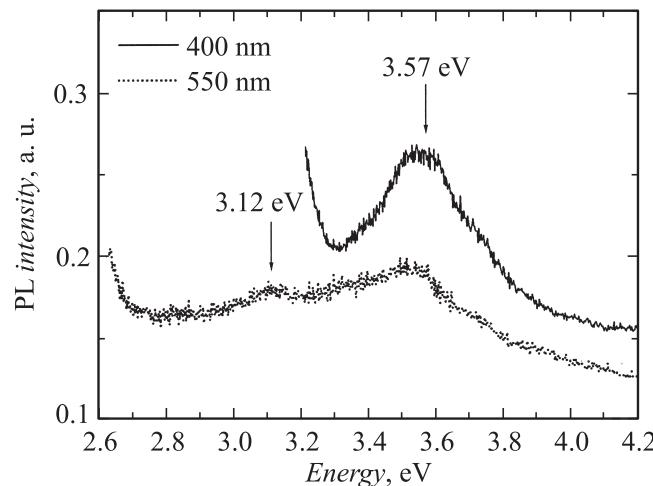


Рис. 3. Спектры возбуждения ФЛ: спектр 1 — на длине волны 400 nm (3.1 eV); спектр 2 — на длине волны 550 nm (2.25 eV).

источника света записать спектр возбуждения в низкоэнергетической части (менее 3.3 eV) не удалось. В спектрах возбуждения ФЛ, записанных на длине волны 550 nm (2.25 eV), также наблюдается основной максимум при энергии возбуждающих фотонов около 3.6 eV и более слабый максимум при энергии фотонов около 3.1 eV (рис. 3, спектр 2).

Таким образом, сопоставляя спектры излучения и возбуждения, можно заключить, что в образцах $\text{SiO}_2:\text{C}$ существуют уровни наиболее эффективного возбуждения ФЛ с энергией около 3.1 и 3.6 eV. При этом состояния, на которых имеет место излучательная рекомбинация, имеют энергию переходов около 2.4–2.5 eV („медленная“ рекомбинация) и 3.0–3.1 eV („быстрая“ рекомбинация).

Обсудим возможную природу излучательных центров. Хорошо известно, что окисление пористого кремния может привести к возникновению голубой ФЛ с максимумом интенсивности около 2.9–3.1 eV (400–430 nm). Было показано, что эта ФЛ определяется дефектами в SiO_2 , связанными с наличием примеси углерода [10]. Кроме того, в работе [11] было показано, что катодолюминесценция из чистого SiO_2 в диапазоне длин волн 380–400 nm возникает только в том случае,

если диэлектрик дополнительно был имплантирован ионами углерода. Позднее аналогичная ФЛ наблюдалась в слоях, полученных с помощью низкотемпературного спекания нанопорошка SiO_2 со средним размером частиц около 7 nm. Частицы порошка предварительно были покрыты монослоем октодецилтрихлорсилана ($\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{17}-\text{SiCl}_3$) [12]. Аналогичная голубая ФЛ наблюдалась также в слоях $\text{Si}:\text{O}:\text{C}$, полученных по последовательной процедурой имплантации углерода в пластины $\text{Si}(111)$ *n*-типа и последующего электрохимического травления [13]. Авторы данной работы пришли к выводу, что голубая ФЛ связана с наличием связей $\text{C}=\text{O}$ на границе окисленных кремниевых нанокластеров. Не конкретизируя структурную модель излучающего центра, мы полагаем, что его „углеродная“ природа в наших образцах $\text{SiO}_2:\text{C}$ также вполне возможна.

Широкая бело-зеленая полоса ФЛ с максимумом интенсивности около 2.4 eV (520 nm) наблюдалась ранее в слоях $\text{SiO}_2:\text{Si}:\text{C}$, полученных с помощью имплантации кремния и углерода в SiO_2 [7], а также в пленках $\text{Si}:\text{O}:\text{C}:\text{H}$, осажденных плазмохимическим методом [3]. Авторы данных работ предположили, что данная ФЛ связана с формированием связей $\text{Si}-\text{C}$ или нанокластеров SiC в матрице оксида кремния. Мы не имеем экспериментальных данных о наличии в наших образцах нанокластеров SiC , однако очевидно, что связи $\text{Si}-\text{C}$ должны иметь место, например, на границе раздела углеродного кластера и матрицы оксида кремния ($\equiv \text{Si}-\text{O}-\text{Si}-\text{C}-\text{C}\equiv$). Кроме того, кремний-углеродные связи могут формироваться при замещении углеродом атома кремния около вакансии кислорода (т. е. дефекта, типа $\equiv \text{Si}-\text{C}\equiv$) по аналогии с другими элементами IV группы, такими как Ge и Sn [1].

Теперь рассмотрим особенности спектров возбуждения (рис. 3). Максимум около 3.6 eV в спектре возбуждения „голубой“ составляющей и излучательную рекомбинацию с энергией 3.1 eV можно ассоциировать с уровнями одного и того же структурного центра (например, типа связи $\text{C}=0$). В низкочастотной области ФЛ спектр возбуждения также имеет максимум около 3.6 eV и дополнительный пик около 3.1 eV. Этот низкоэнергетический уровень возбуждения и рекомбинационный уровень 2.4 eV мы ассоциируем с другим структурным центром (например, связи $\text{Si}-\text{C}$).

На рис. 4 мы приводим предлагаемую упрощенную схему энергетических переходов, участвующих в процессах генерации и рекомбинации. Сплошными линиями показаны переходы возбуждения и безызлуча-

4* Письма в ЖТФ, 2009, том 35, вып. 12

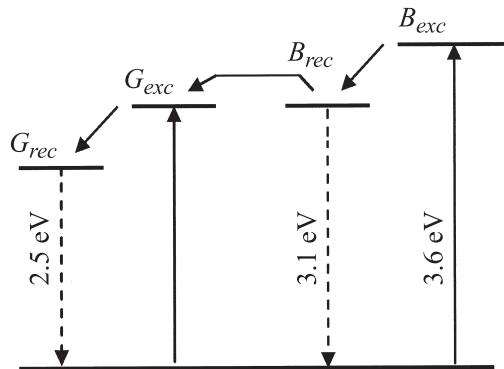


Рис. 4. Энергетическая схема переходов.

тельной релаксации, а пунктирными — излучательные переходы. Для удобства изложения обозначим уровни возбуждения G_{exc} (3.1 eV) и B_{exc} (3.6 eV), а уровни излучательной рекомбинации G_{rec} (2.5 eV) и B_{rec} (3.1 eV). Наличие пика около 3.6 eV в спектрах возбуждения голубой и зеленой полос свидетельствует о том, что часть энергии возбужденных состояний B_{exc} передается уровням возбуждения G_{rec} (рис. 4). Так как энергии уровней B_{rec} и G_{exc} близки (около 3.1 eV), то резонансная передача возбуждения между этими уровнями соответствующих структурных центров вполне может иметь место, если они расположены достаточно близко друг к другу.

Другим нашим экспериментальным наблюдением является значительное уменьшение интенсивности „голубой“ полосы при уменьшении длительности лазерного импульса от 10 до 0.7 ns (рис. 1). Мы полагаем, что этот эффект связан с различным временем высвечивания „зеленой“ и „голубой“ составляющей спектра. Основная часть центров „зеленой“ ФЛ релаксирует за время порядка 340 ns, что значительно больше длительности лазерного импульса. Поэтому уменьшение длительности импульса с 10 до 0.7 ns приводит к уменьшению интенсивности ФЛ соответствующей компоненты пропорционально уменьшению поглощенной мощности излучения.

В случае „голубой“ составляющей ситуация несколько иная. Время высвечивания основной части соответствующих центров 0.3 ns су-

щественно меньше длительности обычного импульса 10 ns. Поэтому вполне вероятно, что один и тот же центр может возбудиться и высыпаться более одного раза за время лазерного импульса. При уменьшении длительности импульса до 0.7 ns время облучения становится сравнимым с характерным временем релаксации „быстрых“ центров и поэтому вероятность многократного возбуждения и высыпчивания одного и того же центра уменьшается. Поэтому для „голубой“ составляющей уменьшение длительности импульса возбуждающего излучения должно иметь больший эффект по сравнению с „зеленой“ компонентой.

В заключение мы подчеркиваем, что ввиду многообразия структурных особенностей рассматриваемого материала чрезвычайно сложно однозначно интерпретировать экспериментальные результаты. Поэтому очевидно, что необходимы дополнительные эксперименты для развития и обоснования детальных структурных моделей излучательных центров и механизмов фотолюминесценции в слоях SiO₂:C.

Работа была выполнена при частичной поддержке Japanese Society of Promotion of Science (JSPS).

Список литературы

- [1] Rebohle L., von Borany J., Fröb H., Skorupa W. // Appl. Phys. B. 2000. V. 71. N 2. P. 131–151.
- [2] Hayashi S., Kataoka M., Yamamoto K. // Jpn. J. Appl. Phys. Part 2. 1993. V. 32. N 2B. P. L264–L276.
- [3] Seo S.-Y., Cho K.-S., Shin J.H. // Appl. Phys. Lett. 2004. V. 84. N 5. P. 717–719.
- [4] Yu Y.H., Wong S.P., Wilson I.H. // Phys. Stat. Sol. (a). 1998. V. 168. N 2. P. 531–534.
- [5] Zhao J., Mao D.S., Lin Z.X., Jiang B.Y., Yu Y.H., Liu X.H., Wang H.Z., Yang G.Q. // Appl. Phys. Lett. 1998. V. 73. N 13. P. 1838–1840.
- [6] Zhao J., Mao D.S., Lin Z.X., Jiang B.Y., Yu Y.H., Liu X.Y., Yang G.Q. // Mater. Lett. 1999. V. 38. N 5. P. 321–325.
- [7] Pérez-Rodríguez A., González-Varona O., Garrido B., Pellegrino P., Morante J.R., Bonafos C., Carrada M., Claverie A. // J. Appl. Phys. 2003. V. 94. N 1. P. 254–262.
- [8] Vasin A.V., Ishikawa Y., Shibata N., Salonen J., Lehto V.-P. // Jpn. J. Appl. Phys. 2007. V. 46. N 17–19. P. L465–L467.
- [9] Muto S., Vasin A.V., Ishikawa Y., Shibata N., Salonen J., Lehto V.-P. // Mater. Sci. Forum. 2007. V. 561–565. P. 1127–1130.

- [10] Kontkiewicz A.J., Kontkiewicz A.M., Siejka J., Sen S., Nowak G., Hoff A.M., Sakthivel P., Ahmed K., Mukherjee P., Witanachchi S., Lagowski J. // Appl. Phys. Lett. 1994. V. 65. N 11. P. 1436–1438.
- [11] Koyama H. // J. Appl. Phys. 1980. V. 51. N 4. P. 2228–2235.
- [12] Sagawa N., Uchino T. // Appl. Phys. Lett. 2005. V. 87. N 25. P. 251923.
- [13] Shi L., Wang Q., Li Y., Xue Ch., Zhuang H. // Appl. Surf. Sci. 2006. V. 252. N 24. P. 8224–8427.